

ОКП 2378205

УДК 776.3.665.225

Группа Э10

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЗАО "Фраст-М"

_____ Д.Б. Аскеров

" ____ " _____ 2007 г.

ФОТОРЕЗИСТ ПОЗИТИВНЫЙ

ФП-РН-7Сэ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 2378-006-29135749-2007

Дата введения _____

Срок действия: не ограничен.

СОГЛАСОВАНО	РАЗРАБОТАНО
Директор ЗАО «Элма-Хим» _____ В.В. Хожанов « ____ » _____ 2007 г.	Вед. технолог ЗАО «Фраст-М» _____ И.Е. Сулейманов « ____ » _____ 2007 г.
Директор ООО «Редхимкомплект» _____ « ____ » _____ 2007 г.	Фотолитограф ЗАО «Фраст-М» _____ В.И. Юдина « ____ » _____ 2007 г.
_____ _____ « ____ » _____ 2007 г.	
_____ _____ « ____ » _____ 2007 г.	

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	<i>стр. 4</i>
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	<i>стр. 4</i>
1.1 Характеристики (свойства)	<i>стр. 4</i>
1.2. Требования к хранению	<i>стр. 4</i>
1.3. Маркировка	<i>стр. 6</i>
1.4. Упаковка	<i>стр. 6</i>
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	<i>стр. 7</i>
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ	<i>стр. 8</i>
3.1 Приёмо-сдаточные испытания	<i>стр. 8</i>
3.2. Типовые испытания	<i>стр. 9</i>
4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	<i>стр. 9</i>
4.1. Общие положения	<i>стр. 9</i>
4.2. Методы отбора проб	<i>стр. 10</i>
4.3. Контроль внешнего вида фоторезиста	<i>стр. 10</i>
4.3.1. Оборудование, материалы, реактивы	<i>стр. 10</i>
4.3.2. Проведение испытаний	<i>стр. 10</i>
4.4. Определение внешнего вида пленки фоторезиста	<i>стр. 11</i>
4.4.1. Принцип определения	<i>стр. 11</i>
4.4.2. Оборудование, материалы, посуда и реактивы	<i>стр. 11</i>
4.4.3. Подготовка к испытаниям	<i>стр. 11</i>
4.4.3.1. Подготовка поверхности подложки	<i>стр. 11</i>
4.4.3.2. Формирования термического окисла кремния	<i>стр. 12</i>
4.4.3.3. Формирование плёнки фоторезиста	<i>стр. 13</i>
4.4.3.4. Проведение испытания	<i>стр. 14</i>
4.5. Определение разрешающей способности	<i>стр. 14</i>
4.5.1. Оборудование, материалы, посуда и реактивы	<i>стр. 14</i>
4.5.2. Подготовка к испытанию	<i>стр. 15</i>
4.5.2.1. Приготовление проявителя	<i>стр. 15</i>
4.5.3. Проведение испытаний	<i>стр. 15</i>
4.6. Определение кинематической вязкости фоторезиста	<i>стр. 16</i>
4.7. Определение толщины пленки фоторезиста	<i>стр. 17</i>
4.7.1. оптические методы	<i>стр. 17</i>

4.7.1.1. Оптический метод 1	стр. 17
4.7.1.1.1. Принцип измерения	стр. 17
4.7.1.1.2. Оборудование, материалы, реактивы	стр. 18
4.7.1.1.3. Подготовка к испытаниям	стр. 18
4.7.1.1.4. Проведение испытания	стр. 18
4.7.1.1.5. Обработка результатов	стр. 18
4.7.1.2. Оптический метод 2	стр. 19
4.7.1.2.1. Принцип измерения	стр. 19
4.7.1.2.2. Оборудование, материалы, реактивы	стр. 21
4.7.1.2.3. Подготовка к испытаниям	стр. 21
4.7.1.2.4. Проведение испытаний	стр. 21
4.7.1.2.5. Обработка результатов	стр. 22
4.7.2. Профилографический метод;	стр. 23
4.7.2.1. Принцип измерения	стр. 23
4.7.2.2. Оборудование	стр. 23
4.7.2.3. Проведение испытаний	стр. 23
4.7.2.4. Обработка результатов	стр. 23
4.8. Определение устойчивости плёнки фоторезиста к проявителю	стр. 24
4.8.1. Оборудование, реактивы	стр. 24
4.8.2. Проведение испытания	стр. 24
4.8.3. Обработка результатов	стр. 24
4.9. Определение относительной скорости фильтрации фоторезиста	стр. 24
4.9.1. Оборудование, материалы, посуда, реактивы	стр. 24
4.9.2. Подготовка к испытанию	стр. 25
4.9.3. Проведение испытания	стр. 25
4.10. Определение массовой доли воды в фоторезисте	стр. 26
4.10.1. Оборудование, посуда, материалы, реактивы	стр. 26
4.10.2. Подготовка к испытанию	стр. 26
4.10.3. Проведение испытаний	стр. 26
4.11. Определение массовой доли сухого остатка	стр. 26
4.11.1. Оборудование, материалы, реактивы	стр. 26
4.11.2. Проведение испытания	стр. 27
4.11.3. Обработка результатов	стр. 27
4.12. Определение массовой доли НХД-групп	стр. 27
4.12.1. Принцип измерения	стр. 27

4.12.2. Оборудование, материалы, реактивы	стр. 27
4.12.3. Подготовка к испытанию	стр. 28
4.12.3.1. Приготовление раствора хромата калия, измерение оптических плотностей	стр. 28
4.12.3.2. Построение графика поправок	стр. 29
4.12.4. Выполнение измерений	стр. 29
4.12.5. Обработка результатов	стр. 30
5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	стр. 30
5.1. Транспортирование	стр. 30
5.2. Хранение	стр. 30
6. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	стр. 31
7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	стр. 31
Приложение 1. Перечень документов	стр. 32
Приложение 2. Перечень оборудования и материалов	стр. 34
Приложение 3. Образец паспорта	стр. 37
Приложение 4. Примеры расчета толщины пленки	стр. 38
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.	стр. 39

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие технические условия разработаны на фоторезист позитивный ФП-РН-7Сэ, именуемый в дальнейшем как «Фоторезист», предназначенный для использования в качестве защитного светочувствительного материала в фотолитографических процессах при изготовлении полупроводниковых приборов, интегральных схем, металлизированных шаблонов, шкал, сеток, печатных плат и др.

Фоторезист может наноситься как методом центрифугирования, так и методом распыления.

Позитивный фоторезист ФП-РН-7Сэ представляет собой композицию состава:

*Светочувствительный продукт,
Феноло и крезолоформальдегидные смолы
Растворители:*

- 1-Метокси-2-пропилацетат (Метоксипропилацетат) экологически безвреден, биологически разлагается.*
- 1,4 Диоксан.*
- Метилэтилкетон*

Метилэтилкетон при постоянном контакте вызывает дерматит, онемение пальцев рук.

Метилэтилкетон – ПДК в воздухе рабочей зоны 200 мг/м^3 , 4 класс опасности по ГОСТ 12.1.005-88.

Метоксипропилацетат раздражает слизистые оболочки глаз. При контакте с кожей раздражение отсутствует.

Метоксипропилацетат - ПДК в воздухе рабочей зоны 275 мг/м^3 , 3 класс опасности по ГОСТ 12.1.005-88.

1,4 Диоксан является ядом наркотического действия, избирательно влияет на почки, печень. 1,4 Диоксан обладает кумулятивными свойствами.

1,4 Диоксан – ПДК 10 мг/м^3 , 3 класс опасности по ГОСТ 12.1.005-88.

Правила установления допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу определяют по ГОСТ 17.2.3.02-78 "Охрана природы. Атмосфера".

Условное обозначение продукта при заказе и в технической документации:

"Фоторезист позитивный ФП-РН-7Сэ, ТУ 2378-006-29135749-2007".

Документы, на которые в соответствующих разделах ТУ даны ссылки, следует применять с настоящими техническими условиями.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Фоторезист должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящих технических условий по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.1. Характеристики (свойства).

Фоторезист должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.1.

*Таблица 1. Параметры «Фоторезиста».

№ п/п	Наименование параметров и характеристик	Норма
1	Внешний вида	Прозрачная жидкость красно-коричневого цвета
2	Внешний вид пленки	Прозрачная, блестящая, без разрывов
3	Минимальная ширина воспроизводимого элемента	1,0
4	Кинематическая вязкость при температуре $20,0 \pm 0,1$ °С, мм ² /с	2,2-2,7
5	Толщина пленки фоторезиста, мкм	0,5-0,8
6	Устойчивость пленки фоторезиста к проявителю, мин, не менее	15,0
7	Относительная скорость фильтрации фоторезиста, отн. ед., не более	2,0
8	Массовая доля воды, %, не более	0,6
9	Массовая доля сухого остатка, % в пределах	19,0-22,0
10	Массовая доля НХД-групп в пересчете на сухой остаток, % в пределах	11,5-15,0

1.2. Требования к хранению.

Минимальный срок гарантийного хранения Фоторезиста 6 месяцев при условии хранения его в таре предприятия-изготовителя в закрытом отапливаемом помещении, снабженном приточно-вытяжной вентиляцией, при температуре (20 ± 5) °С и относительной влажности воздуха не более 80%.

1.3. Маркировка.

На каждую бутылку должна быть наклеена этикетка, на которой указывают:

- ◆ наименование предприятия-изготовителя;
- ◆ наименование продукта;
- ◆ массу нетто;
- ◆ номер партии;
- ◆ дату изготовления;
- ◆ штамп отдела технического контроля (ОТК);
- ◆ условное обозначение номера ТУ;
- ◆ гарантийный срок хранения.
- ◆ На отдельной этикетке в соответствии с ГОСТ 19433-88 указывают знак опасности.

1.4. Упаковка.

Транспортную тару маркируют в соответствии с ГОСТ 14192-96 с дополнительными надписями:

- ◆ наименования предприятия-изготовителя;
- ◆ наименования продукта;
- ◆ количества упакованных в транспортную тару мест и массу нетто каждого места;
- ◆ массы брутто;
- ◆ номера партии;
- ◆ даты изготовления.
- ◆ В соответствии с ГОСТ 14192-96 указывают манипуляционные знаки: "Хрупкое. Осторожно", "Беречь от нагрева", "Беречь от влаги", "Беречь от излучения", "Верх".
- ◆ По ГОСТ 19433-88 указывают знак опасности и классификационный шифр 3212.

Фоторезист расфасовывают и упаковывают в стеклянные бутылки коричневого цвета БВ-1-1000, со светозащитными свойствами, с навинчивающимися крышками из полимерных материалов и полиэтиленовыми прокладками изготовленные по ГОСТ Р 51477-1999, без обертывания в светонепроницаемую бумагу.

Фоторезист в потребительской таре помещают в ящики из гофрированного картона для химической продукции по ГОСТ 13841-95 Бутылки в ящике снизу, сверху и в вертикальных плоскостях уплотняют гофрированным картоном (ГОСТ 7376-89) или пенополиуретаном в виде гнезд, исключая возможность перемещения внутри ящика.

В каждый ящик со стороны крышки вкладывают упаковочный лист с указанием:

- ◆ наименования предприятия-изготовителя;
- ◆ наименования продукта;

- ◆ номера партии и даты изготовления;
- ◆ количества и массы нетто упакованных в ящик мест;
- ◆ условного обозначения ТУ.

Картонные ящики с продуктом склеивают бумажными или полиэтиленовыми лентами с липким слоем (ГОСТ 20477-86). Каждую партию фоторезиста или часть партии, отгружаемую потребителю, сопровождают паспортом.

Образец паспорта приведен в «Приложении 3».

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Фоторезист - легковоспламеняющаяся жидкость. Температура вспышки в открытом тигле 11 °С. Температура самовоспламенения 340°С. Температурные пределы воспламенения: нижний – 4°С, верхний – 58°С. Область воспламенения 1,8-23,4 объемных процентов (определение проводят по ГОСТ 12.1.044-89)

Все электрооборудование и освещение помещения при изготовлении Фоторезиста должно быть выполнено во взрывобезопасном исполнении. В помещении, где применяется Фоторезист, запрещается использование открытых источников нагревания.

Средства пожаротушения: химическая пена, тонкораспыленная вода, воздушно-механическая пена, газовые огнегасительные составы.

Фоторезист - вещество умеренно опасное, 3 класс опасности по ГОСТ 12.1.005-88.

Раздражает слизистые оболочки глаз. При контакте с кожей раздражение отсутствует.

При работе с фоторезистом контроль над состоянием воздуха рабочих помещений следует вести по метоксипропилацетату и 1,4 диоксану.

Периодичность контроля определяют по ГОСТ 12.1.005-88.

Метоксипропилацетат - ПДК в воздухе рабочей зоны 275 мг/м³, 3 класс опасности по ГОСТ 12.1.005-88.

1,4 Диоксан – ПДК 10 мг/м³, 3 класс опасности по ГОСТ 10455-80.

Технологический процесс изготовления Фоторезиста должен быть автоматизирован, а оборудование герметизировано.

Помещение, где проводится работа с продуктом, должно быть оборудовано общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией обеспечивающей ПДК в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88. В местах возможного выделения вредных веществ должны быть оборудованы местные вентиляционные отсосы.

Каждую смену проводить влажную уборку помещения.

Перед работой рекомендуется наносить на кожу рук защитные кремы.

При отборе проб, испытании и применении фоторезиста следует применять индивидуальные средства защиты (резиновые перчатки, защитные очки, спецодежда) в соответствии с ГОСТ 12.4.011-89 и ГОСТ 12.4.103-83, а также соблюдать правила личной гигиены.

При попадании на кожу фоторезист необходимо снять ватным тампоном и тщательно вымыть участок кожи водой с мылом. При производстве Фоторезиста сточные воды не образуются. Фоторезист и входящие в него компоненты не образуют токсичных соединений в воздушной среде и в присутствии других веществ. Уничтожают отходы Фоторезиста сжиганием. Сжигание рекомендуется проводить в печах камерного типа или циклонно - плавильных агрегатах (ЦПА) при температуре 850-1000 °С с последующим пропуском отходящих газов через скрубберы, орошаемые 2-20 %-ным раствором щелочи. Абсорбент из скруббера следует направлять на сжигание в ЦПА, а сплав солей из ЦПА - в шламоотвал.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

Фоторезист поставляют с приемкой отделом технического контроля (ОТК).

Для проверки Фоторезиста на соответствие требованиям настоящих технических условий устанавливают приемо-сдаточные испытания.

3.1. Приемо-сдаточные испытания

На испытания и приемку Фоторезист предъявляют партиями, упакованными в соответствии с п.1.5 настоящих ТУ.

За партию принимают количество однородного по своим качественным показателям фоторезиста, полученного в результате одного технологического цикла и оформленного одним документом о качестве. Масса партии каждого фоторезиста должна быть не более 500 кг. Порядок отбора проб на приемо-сдаточные испытания в соответствии с ГОСТ 3885-73.

Масса средней пробы фоторезиста должна быть 600 г.

Состав и последовательность приемо-сдаточных испытаний приведены в таблице 2.

Партию Фоторезиста считают выдержавшей приемо-сдаточные испытания, если по всем видам испытаний получены положительные результаты.

При получении отрицательных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей, установленных в ТУ, проводят повторные испытания по всем показателям, в соответствии с таблицей 2 на пробе, отобранной от удвоенного количества упаковочных единиц той же партии Фоторезиста.

В технически обоснованных случаях допускается повторные испытания проводить только по тому виду испытаний, по которому получены отрицательные результаты.

Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.

Партию фоторезиста, не выдержавшую повторных испытаний, забраковывают и изолируют от годных партий.

Состав и последовательность приемо-сдаточных испытаний.

Таблица 2

№ п/п	Наименование параметров и характеристик	Номер пункта	
		Технических требований	Методов испытаний
1	<i>Определение внешнего вида фоторезиста</i>	1	4.3
2	<i>Определение внешнего вида пленки</i>	2	4.4
3	<i>Определение минимальной ширины воспроизводимого элемента</i>	3	4.5
4	<i>Определение кинематической вязкости</i>	4	4.6
5	<i>Определение толщины пленки фоторезиста</i>	5	4.7
6	<i>Определение устойчивости пленки фоторезиста к проявителю</i>	6	4.8
7	<i>Определение относительной скорости фильтрации фоторезиста</i>	7	4.9
8	<i>Определение массовой доли воды</i>	8	4.10
9	<i>Определение массовой доли сухого остатка</i>	9	4.11
10	<i>Определение массовой доли НХД-групп</i>	10	4.12

Партии Фоторезиста, прошедшие приемо-сдаточные испытания с положительными результатами, считаются принятыми, их упаковывают, клеймят и сдают на склад готовой продукции.

3.2. Типовые испытания.

Типовые испытания проводят по ГОСТ В 15.307-77.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.

4.1. Общие положения.

Общие указания по проведению испытаний в соответствии с ГОСТ 27025-86.

Испытания Фоторезиста проводят в следующих климатических условиях:

температура воздуха 15 - 25 °С;

относительная влажность воздуха в пределах 40 - 60%;

атмосферное давление от 84 до 106 кПа (630-800 мм рт.ст.) При отборе проб и испытаниях фоторезист следует оберегать от

воздействия дневного света, света люминесцентных ламп и ламп накаливания.

Рабочим (не актиничным) освещением является освещение, фильтрованное через стекло органическое техническое оранжевое или красное толщиной 4-5 мм по ГОСТ 17622-72.

4.2. Методы отбора проб

Отбор проб Фоторезиста проводят по ГОСТ 3885-73 с помощью толстостенной трубки.

Среднюю пробу тщательно перемешивают, делят на две равные части - лабораторную и контрольную пробы и помещают в чистые сухие бутылки из коричневого стекла БВЛ-400 или БВЛ-500 по ТУ 6-09-5472-90 с навинчивающимися крышками и полиэтиленовыми прокладками по ТУ 6-09-5311-89.

На бутылки наклеивают этикетку со следующим содержанием:

- ◆ наименование предприятия-изготовителя;
- ◆ номер партии;
- ◆ наименование продукта;
- ◆ номер или вид пробы;
- ◆ дата отбора пробы;
- ◆ фамилия пробоотборщика.

Лабораторную пробу используют для проведения испытаний, контрольную хранят в условиях, обеспечивающих сохранность продукта в течение 6 месяцев для арбитражного контроля.

4.3. Контроль внешнего вида Фоторезиста

4.3.1. Оборудование, материалы, реактивы

Люксметр Ю-116, ТУ 25-04-3098-76 или аналогичный

Воронка В-36-80 ХС по ГОСТ 25336-82

Цилиндр 1-10 по ГОСТ 1770-74

4.3.2. Проведение испытания

Внешний вид Фоторезиста оценивают визуально. 5 - 7 см³ фоторезиста наливают через воронку В-36-80 ХС ГОСТ 25336-82 в цилиндр 1-10 ГОСТ 1770-74 и рассматривают в проходящем дневном свете при освещенности не менее 2000 лк.

Допускается использование люминесцентных ламп дневного или белого свечения.

Внешний вид Фоторезиста должен соответствовать требованиям п. 1 таблицы 1 настоящих технических условий.

Для дальнейших испытаний эта порция фоторезиста непригодна.

4.4. Определение внешнего вида пленки фоторезиста

4.4.1. Принцип определения

Метод основан на визуальном осмотре пленки фоторезиста на наличие комет, темных и светлых точек, пятнистости, видимых невооруженным глазом в отраженном свете, направленном под углом к поверхности пластины.

4.4.2. Оборудование, материалы, посуда и реактивы

- ◆ Электропечь диффузионная СДО-125/3-15, ДЕМ 3.017.03110 или аналогичная.
- ◆ Устройство для нанесения фоторезиста в скафандре ЦНФ-6ц-Д-130-3, ДЕМ 3.281.008 или аналогичное.
- ◆ Пластины монокристаллического кремния диаметром 40 , 60 или 76мм.
- ◆ Шкаф сушильный электрический, обеспечивающий температуру нагрева от 60 до 200 °С с точностью ± 3 °С.
- ◆ Термометр технический стеклянный ТТП №6 по ТУ 25-2021.010-89 или аналогичный.
- ◆ Шприц "Sartorius" SM 16620 с фильтродержателем SM 16214 или аналогичный.
- ◆ Ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ по ГОСТ 13045-81 с регулятором расхода воздуха РРВ-1.
- ◆ Секундомер механический СОПр.-2А-3 по ГОСТ 5072-79 или аналогичный.
- ◆ Пинцет лабораторный по ТУ 45-6А0.005.088 ТУ-86 или аналогичный.
- ◆ Фильтры "Владипор" типа МФЦ N2 по ТУ 6-05-1978-84 , допускается использование других, стойких к органическим растворителям фильтров с диаметром пор не более 0,5 мкм.
- ◆ Бязь хлопчатобумажная (отбеленная) по ГОСТ 29298-92, салфетки размером 100х100 мм.
- ◆ Вата хлопчатобумажная.
- ◆ Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-87, высший сорт.
- ◆ Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.
- ◆ Кислород газообразный технический по ГОСТ 5583-78 изм.1,2,3,4.

4.4.3. Подготовка к испытанию

4.4.3.1. Подготовка поверхности подложки

В качестве подложки используют пластину монокристаллического кремния, на поверхности которой формируют термический окисел кремния.

Кварцевую трубу перед проведением процесса окисления кремниевых пластин промывают этиловым спиртом с помощью ватного тампона, покрытого батистовой салфеткой; рабочий стол, пинцет, крюк

кварцевый, лодочку кварцевую и подставку тщательно протирают батистовой салфеткой, смоченной этиловым спиртом. Рабочий стол, лодочку и подставку протирают один раз в начале работы, крюк и пинцет протирают перед загрузкой и выгрузкой каждой партии пластин.

Расход спирта на подготовительные работы 300 см³.

Включают электропечь в сеть согласно инструкции по эксплуатации.

Готовят систему увлажнения кислорода:

барботер наполняют дистиллированной водой на две трети высоты, при этом конец трубки соединительного элемента, по которой кислород поступает в барботер, должен быть погружен в воду не менее, чем на 2 см;

барботер помещают в водяную баню и заполняют баню дистиллированной водой до уровня на 2-3 см ниже верхнего края бани. Баню включают в сеть примерно за 30 мин до начала процесса окисления.

К началу процесса баня должна быть нагрета до кипения.

4.4.3.2. Формирование термического окисла кремния

При формировании термического окисла кремния температура в рабочей зоне печи должна быть в пределах 1100-1150 °С.

После выхода печи на рабочий температурный режим (через 1,5-2 ч после включения печи в сеть) подключают к трубе печи систему подачи кислорода и устанавливают расход кислорода 150 л/ч по ротаметру в соответствии с таблицей или графиком, приведенными в паспорте к ротаметру.

Установленный уровень расхода поддерживают постоянным на протяжении всего процесса окисления.

Продувают трубу кислородом в течение 10 мин.

Лодочку для пластин помещают на подставку. Каждую пластину берут пинцетом за краевую область, не далее 3 мм, и устанавливают в лодочку таким образом, чтобы при проведении процесса окисления нерабочая поверхность пластины была обращена к потоку кислорода.

Постепенно, в течение 1,5-2,0 мин с помощью кварцевого крюка подвигают лодочку с пластинами в рабочую зону печи.

В течение (10 ± 1) мин продувают трубу сухим кислородом.

С помощью соединительного элемента подключают к трубе систему увлажнения и в течение (45 ± 1) мин продувают трубу кислородом, предварительно пропущенным через барботер с дистиллированной водой.

Отключают от трубы систему увлажнения кислорода.

В течение (10 ± 1) мин продувают трубу сухим кислородом.

Отключают подачу кислорода.

С помощью кварцевого крюка медленно, в течение 1,5-2,0 мин, выдвигают лодочку с пластинами из рабочей зоны печи на подставку и выдерживают на воздухе не менее 30 мин для охлаждения. Каждую пластину берут пинцетом за краевую область, не далее 3 мм, и визуально осматривают рабочую поверхность пластины. Пригодной для работы считают пластину, на всей рабочей поверхности которой, без учета краевой области, сформирован равномерный блестящий, без пятен, разводов и эрозии слой окисла от красно-фиолетового до зеленовато-желтого цвета, что соответствует толщине окисла 0,46-0,56 мкм.

В случае, когда процесс не обеспечивает заданную толщину окисла, допускается варьирование времени пропускания влажного кислорода в диапазоне 40-60 мин.

Пригодные для работы пластины помещают в кассету. Пластины, не используемые сразу после окисления, хранят в потребительской таре. Для испытаний используют свежие окисленные пластины. В случае разрыва во времени между операциями окисления пластин и нанесения фоторезиста более 8 ч прокаливают пластины в электропечи в течение 20 мин при температуре не менее 800 С.

Кварцевую трубу перед прокаливанием пластин промывают этиловым спиртом с помощью ватного тампона, покрытого батистовой салфеткой; рабочий стол, пинцет, лодочку кварцевую, крюк кварцевый и подставку тщательно промывают батистовой салфеткой, смоченной спиртом.

Расход спирта на подготовительные работы 300 см³.

Допускается прокаливание пластин проводить в электропечи типа СНОЛ-1,6.2,5.1/11-И2 или аналогичной, используя при этом отрезок кварцевой трубы длиной 200 мм.

Расход спирта 60 см³.

После проведения прокаливания лодочку с пластинами выдвигают из рабочей зоны печи на подставку и выдерживают на воздухе не менее 30 мин для охлаждения.

4.4.3.3. Формирование пленки фоторезиста

Перед началом работы центрифугу и внутреннюю поверхность скафандра - устройства для нанесения фоторезиста (ЦНФ) тщательно протирают бязевой салфеткой, смоченной этиловым спиртом.

Расход спирта 60 см³.

Каждую пластину извлекают из кассеты пинцетом и закрепляют на центрифуге устройства для нанесения фоторезиста.

С помощью шприца через фильтр "Владипор" наносят на пластину 8-10 капель фоторезиста, дают растечься по поверхности в течение 3-4 с и включают центрифугу.

Время вращения ротора центрифуги составляет 60 сек, при частоте вращения $3000 \pm 300 \text{ мин}^{-1}$.

Пластины со сформированной пленкой с помощью пинцета устанавливают в кассету и выдерживают:

- ◆ в скафандре при температуре $18 - 23^{\circ}\text{C}$ в течение 20 мин;
- ◆ в сушильном шкафу при температуре $(80 \pm 3)^{\circ}\text{C}$ в течение 20 мин;
- ◆ в скафандре при температуре $18-23^{\circ}\text{C}$ не менее 30 мин.

4.4.3.4. Проведение испытания

Внешний вид пленки Фоторезиста определяют визуально на двух пластинах в рассеянном свете под разными углами зрения.

Результаты испытания считают положительными, если в пленке отсутствуют сыпь, муть, разрывы и внешний вид пленки соответствует требованиям п.2 табл. 1 настоящих ТУ.

4.5. Определение разрешающей способности пленки фоторезиста. Разрешающую способность пленки Фоторезиста (минимальную ширину воспроизводимого элемента) определяют путем получения контактным способом изображения фотошаблона - теста, по которому с помощью микроскопа контролируют геометрическую форму элементов, выполнение их в пределах допуска и чистоту проявления.

4.5.1. Оборудование, материалы, посуда и реактивы

- ◆ Установка совмещения и экспонирования (УСЭ) типа ЭМ-576.Я2М2.252.131 или аналогичная.
- ◆ Люксметр, позволяющий замерить освещенность в пределах 40000-50000 лк, Ю-116, ТУ 25-04-3098-76 или аналогичный.
- ◆ Микроинтерферометр Линника МИИ-4 по ТУ 3-3.1145-81 или аналогичный.
- ◆ Устройство для нанесения фоторезиста в скафандре ЦНФ по ДЕМ 3.281.008 или аналогичное.
- ◆ Фотошаблон-тест, черт. И 6М7.409.557 НИИМЭ.
- ◆ Весы лабораторные 2 класса точности с пределом взвешивания до 200 г по ГОСТ 24104-2001 или аналогичные.
- ◆ Баня водяная лабораторная одноместная по ТУ 10-23-28-87.
- ◆ Секундомер механический по ТУ 25-1819.0021-90.
- ◆ Пинцет лабораторный по ТУ 45-6АО.005.088 ТУ-86 или аналогичный.
- ◆ Термометр лабораторный №2 с диапазоном измерения температуры от 0 до 100°C и ценой деления шкалы 1°C по ТУ 25-2021.003-88 или аналогичный.
- ◆ Бязь хлопчатобумажная (отбеленная) по ГОСТ 11680-76, салфетки размером 100x100 мм.
- ◆ Батист отбеленный по ГОСТ 8474-80, салфетки размером 100 x 100 мм.
- ◆ Фильтры бумажные обеззоленные "синяя лента" по ТУ 6-09-1678-86.

- ◆ Банка полиэтиленовая с прокладкой и крышкой БЦ -1000 по ТУ 6-19-110-78.
- ◆ Колба 2-1000-2 ГОСТ 1770-74.
- ◆ Спирт этиловый ректифицированный технический по ГОСТ 18300-87, высший сорт.
- ◆ Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

4.5.2. Подготовка к испытанию

4.5.2.1. Приготовление проявителя

В качестве проявителя используют 1% раствор гидроокиси калия или 0,4% раствор гидроокиси натрия. Допустимая погрешность приготовления раствора 0,02%.

Гидроокись калия или натрия анализируют по ГОСТ 24363-80 на содержание основного вещества. Навеску гидроокиси калия или натрия, рассчитанную с учетом содержания основного вещества, взвешивают с погрешностью не более 0,001 г, переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см³ и растворяют в дистиллированной воде.

Раствор охлаждают, тщательно перемешивают и фильтруют через бумажный фильтр "синяя лента". Титр раствора устанавливают через 30 мин по ГОСТ 24363-80.

Хранят проявитель в полиэтиленовой банке с прокладкой и крышкой. Срок годности проявителя трое суток.

4.5.3 Проведение испытания.

Испытания проводят на пластинах, подготовленных по п.4.4.3 в количестве не менее пяти штук. Пленку фоторезиста экспонируют на установке УСЭ через фотошаблон-тест согласно инструкции по эксплуатации установки. Фотошаблон-тест, шаблонодержатель и другие доступные элементы устройства совмещения установки протирают батистовыми салфетками, смоченными спиртом. Расход спирта 60 см³.

Время экспонирования и проявления зависит от типа источника освещения, величины освещенности и толщины пленки фоторезиста.

Оптимальные время экспонирования и время проявления устанавливают экспериментально.

За оптимальное время принимают то время, при котором на проявленных элементах не остается следов фоторезиста, ширина и геометрическая форма проявленных элементов соответствуют ширине и геометрической форме элементов фотошаблона-теста.

При использовании в качестве источника облучения лампы ДРШ-350 и освещенности на пластине 40000-50000 лк время экспонирования составляет 5-20 сек.

Прозэкспонированную пленку проявляют, погружением пластины на 5-45 сек в ванну с 50 см³ проявителя при температуре 19-21 °С, слегка

покачивая пластину пинцетом. Проявленную пленку сушат на центрифуге устройства ЦНФ при частоте вращения ротора центрифуги 3000 об/мин в течение 60 сек. Полученное изображение фотошаблона-теста рассматривают на микроинтерферометре при 500-кратном увеличении. В поле зрения микроскопа вводят группу из трех прямоугольников фрагмента N 4 (рис. 1).

Рассматривают группу из трех прямоугольников ("вилку") с неискаженной геометрической формой, находящуюся в столбце, соответствующем отклонению от номинального значения на фотошаблоне-тесте и строке 2. Если в паспорте на фотошаблон-тест отмечено отклонение размера элемента в "+", то определение проводят в темнопольном изображении фрагмента N 4, а при отклонении размера в "-" на светлопольном.

Контроль отклонения размеров производят по взаимному расположению длинных сторон верхнего и нижнего прямоугольников.

Если размеры выполнены вне допуска $\pm 0,3$ мкм относительно фотошаблона-теста, то наблюдается одновременное перекрытие между продолжениями длинных сторон прямоугольников 1,3 и 2,3 или наличие зазоров между ними (рис. 2).

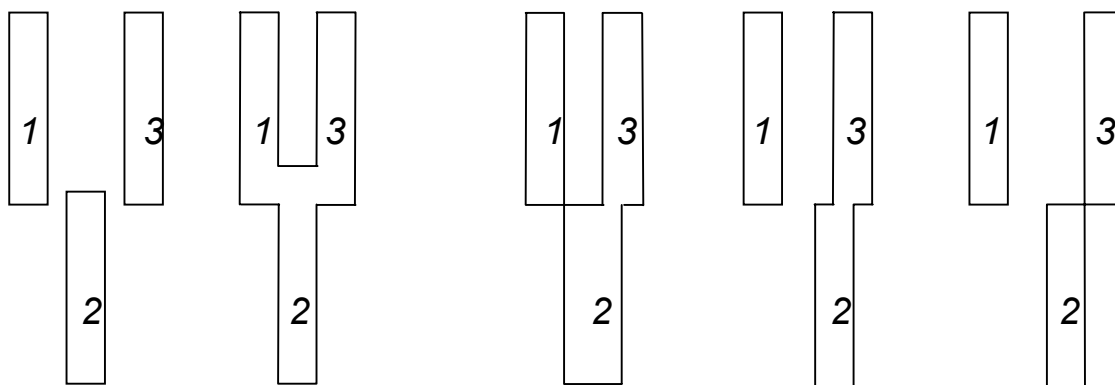


Рис. 1.

Рис. 2

Во всех остальных случаях размер выполнен в пределах допуска. Результаты испытаний считают положительными, если при визуальной оценке на проявленных элементах нет следов фоторезиста, пленка фоторезиста не имеет дефектов, размер элементов выполнен в пределах допуска и соответствует требованиям п.3 табл. 1 настоящих технических условий.

4.6. Определение кинематической вязкости фоторезиста.

Кинематическую вязкость Фоторезиста определяют по ГОСТ 33-2000 при температуре $(20,0 \pm 0,1)$ °С с помощью вискозиметра ВПЖ-2 ГОСТ 10028-81 (диаметр капилляра 0,99 мм). При этом 15-20 см фоторезиста наливают с помощью цилиндра 1-25 ГОСТ 1770-74 через воронку В-36-80 ХС ГОСТ 25336-82 в широкое отверстие вискозиметра.

Для дальнейших испытаний эта порция фоторезиста непригодна.

После определения вязкости вискозиметр тщательно моют этилцеллозольвом, ацетоном, водой и хромовой смесью, приготовленной из двуххромовокислого калия по ГОСТ 4220-75 и серной кислоты по ГОСТ 4204-77. Затем многократно промывают дистиллированной водой по ГОСТ 6709-72, ополаскивают этиловым спиртом по ГОСТ 18300-87 и сушат в слабом потоке очищенного воздуха. Расход спирта 15 см^3 . Результаты испытаний считают положительными, если кинематическая вязкость фоторезиста соответствует требованиям п.4 таблицы 1 настоящих технических условий.

4.7. Определение толщины пленки фоторезиста

Определение толщины пленки фоторезиста проводят любым из трех предложенных далее методов, после сушки пленки до ее экспонирования. Первые два метода (Метод 1 и Метод 2) являются оптическими. Используется микроинтерферометр Линника, типа МИИ-4 или аналогичный. Метод 3 использует профилограф-профилометр. Толщина пленки фоторезиста является определяющей в процессах фотолитографии и на практике может представляться геометрической толщиной в мкм (по методам 1 и 3), или в числах длин волн, укладываемых в оптическую толщину пленки (по Методу 2). При сушке пленки меняется содержание остаточных растворителей, показатель преломления (n), геометрическая толщина (d). Таким образом, геометрическая толщина пленки только косвенно определяет свойства фоторезиста.

Оптическая толщина пленки $2nd$ может быть определена независимо от состояния пленки фоторезиста после сушки по числу длин волн, укладываемых в оптическую толщину пленки (по Методу 2).

4.7.1 Оптические методы.

При испытаниях руководствуются инструкцией по эксплуатации микроинтерферометра МИИ-4.

Погрешность интерференционных измерений линейных размеров указана в паспорте прибора и является наименьшей из всех известных методов измерений размеров и длин, сопоставимых с длиной волны в видимой области спектра.

4.7.1.1 Оптический метод 1.

Метод предназначен для определения толщины пленки фоторезиста на микроинтерферометре.

4.7.1.1.1. Принцип измерения

Метод основан на измерении сдвига интерференционных полос, образующихся при взаимодействии двух световых пучков, один из которых отражается от поверхности пленки алюминия, напыленной на пленку фоторезиста, а другой - от поверхности пленки алюминия, напыленной на подложку.

4.7.1.1.2. Оборудование, материалы, реактивы

Пост вакуумный универсальный ВУП-4 по ТУ 25-05-1771-75 или аналогичный, позволяющий напылять пленку алюминия толщиной 0,1-0,2 мкм.

Микроинтерферометр Линника МИИ-4 по ТУ 3-3.1145-81 или аналогичный.

Проволока вольфрамовая марки ВА по ОСТ 11.021-002-76 диаметром 1,0 мм.

Проволока из алюминия марки А-995 по ТУ 48-21-574-77 диаметром 0,35-0,50 мм.

Бязь хлопчатобумажная (отбеленная) по ГОСТ 11680-76, салфетки размером 100x100мм.

Спирт этиловый ректифицированный технический по ГОСТ 18300-87, высший сорт.

4.7.1.1.3. Подготовка к испытанию.

На пластину с изображением рисунка, полученного по п.4.5.3 напыляют пленку алюминия толщиной 0,1-0,2 мкм согласно инструкции по эксплуатации поста вакуумного универсального. В качестве испарителя используют вольфрамовую проволоку. Перед напылением подколпачное резиновое уплотнение протирают батистовой салфеткой, смоченной этиловым спиртом.

Расход спирта 10 см³.

4.7.1.1.4. Проведение испытания

Толщину пленки фоторезиста (рис. 3) измеряют на микроинтерферометре, руководствуясь инструкцией по эксплуатации.

Пленка фоторезиста



Рис.3. Измерение толщины пленки на микроинтерферометре МИИ-4.

4.7.1.1.5. Обработка результатов.

Толщину пленки фоторезиста определяют по формуле:

$$h = 0,27 * \frac{N_1 - N_3}{N_1 - N_2} \quad (1)$$

где h - толщина пленки фоторезиста, мкм;

N_1-N_2 - величина интервала между полосами, выраженная в делениях барабана окулярного микрометра;

0,27 - коэффициент при работе с белым светом, мкм;

N_3 - величина изгиба полосы, выраженная в делениях барабана окулярного микрометра.

Результаты испытания считают положительными, если толщина пленки фоторезиста соответствует п.7 табл.1 настоящих технических условий.

4.7.1.2. Оптический метод 2.

предназначен для определения «толщины пленки» фоторезиста, выраженного в числе длин волн, укладываемых в оптической толщине пленки.

Метод 2 отличается простотой исполнения и пригоден для быстрого экспресс - контроля толщины и воспроизводимости толщин пленок в цеховых условиях.

4.7.1.2.1. Принцип измерения.

Метод основан на интерференции света в тонких прозрачных пленках на отражение.

Толщина пленки фоторезиста измеряется количеством (числом) заданной длины волны света зондирующего излучения, укладываемой в ее оптическую толщину " $2nd$ ", согласно формулам (1) или (2).

В пленке фоторезиста на кремниевой подложке, методом фотолитографии формируется канавка с наклонным краем, которая становится точным интерференционным прибором - "тонкой пленкой переменной толщины".

В МИИ-4, используемого как микроскоп, на наклонной поверхности края канавки в пленке фоторезиста, наблюдают интерференционные полосы (полосы равной толщины локализованные на наклонной поверхности пленки). Интерференцию наблюдают в зеленом монохроматическом свете интерференционного фильтра осветителя МИИ-4.

Визуально отсчитывают число полос (m) интерференции, целых или полуцелых, укладываемых на наклонном участке края канавки от подложки до поверхности пленки фоторезиста. Отсчитывается число интервалов между светлыми полосами, в том числе от светлой подложки (целое число) и последняя половина интервала, если поверхность пленки наблюдается темной (полуцелое число).

При измерении на не окисленном кремнии результат представляют в виде числа $N = (m - \varphi) : \varphi$: от полученного числа (m) отнимают $\varphi=0,5$.

При измерении на диэлектриках $\varphi=0$ и результат представляют в виде полученного целого или полуцелого числа (m).

Оптическая толщина пленок определяется из выражения:

$$2 * n * d = (m - \varphi) * L \quad (2)$$

где:

d - геометрическая толщина пленки фоторезиста, мкм;

n - показатель преломления пленки фоторезиста, $n \approx 1,52$;

m - порядок интерференции: целое или полуцелое число длин волн, укладывающихся в оптической толщине ($2 * n * d$) пленки фоторезиста;

L - длина волны в мкм, зеленого или желтого интерференционного светофильтра в осветителе микроинтерферометра МИИ-4, согласно паспорту; например, у зеленого светофильтра к МИИ-4 $L = 0,534$ мкм или аналогичная длина волны зеленого светофильтра;

φ - потеря фазы при отражении света на границе раздела между подложкой и пленкой фоторезиста;

$\varphi = 0,5$ - на не окисленном Si или металлической отражающей поверхности;

$\varphi = 0$ - на диэлектриках: стекло, SiO_2 , и т.п.

Можно видоизменить формулу (2) в формулу (3):

$$N = (m - \varphi) = \frac{2 * n * d}{L} \quad (3)$$

Согласно выражению (2), число длин волн (или полос равной толщины), укладывающихся в оптической толщине ($2 * n * d$) пленки фоторезиста не вычисляют, а определяют прямым подсчетом на реальной, пленке (диэлектрическом покрытии) и полученный результат используют как "мера толщины пленки". При этом не нужно определять показатель преломления и геометрическую толщину пленки. При измерениях задается только длина волны монохроматического зондирующего света в видимой области спектра (например: зеленый или желтый в осветителе МИИ-4, длина волны He-Ne ОКГ известная точно как 0,6328 мкм, или линии ртутового спектра, свет, отфильтрованный через монохроматор и т.п.).

Значение погрешности визуального определения расстояния между светлой и темной полосой последнего пол-интервала составляет:

-не более $\pm 1/4$ ширины интерференционной полосы или выраженная в мкм для $L=0,534$ мкм и $n=1,52$:

-не более $L/8n$ согласно формуле (2):

$$\Delta d = \pm \left(\frac{1}{4} * \frac{L}{2n} \right) \approx \pm 0,044 \text{ мкм}$$

При необходимости измеряемая толщина пленки может быть пересчитана в (мкм) по формуле (3), полученной на основании формулы (2):

$$d = \frac{(m - \varphi) * L}{2n} = (m - 0,5) * 0,176 \text{ мкм} \quad (3)$$

где: $n = 1,52$; $L = 0,534$ мкм; $\varphi = 0,5$ на не окисленном кремнии.

4.7.1.2.2 Оборудование, материалы, реактивы

Микроинтерферометр Линника МИИ-4 по ТУ 3-3.1145-81 или аналогичный.

Кремний полированный не окисленный - для полупроводниковых приборов: марка, тип, размер не нормируются.

4.7.1.2.2. Подготовка к испытаниям.

На кремниевой полированной не окисленной пластине методом центрифугирования при $(3000 + 300)$ об/мин формируют пленку фоторезиста. Сушат на воздухе 20 мин при комнатной температуре, затем в сушильном шкафу 20 мин при температуре $(95 + 3) ^\circ\text{C}$. После сушки в шкафу пленку фоторезиста выдерживают на воздухе 20 мин при комнатной температуре и затем направляют на формирование ступеньки с наклонным краем методом фотолитографии.

В пленке фоторезиста, на подложке, методом фотолитографии формируется ступенька или канавка глубиной до подложки, с пологими (наклонными) краями. Длина пологого края ступеньки или канавки должна быть от 5 до 20 толщин пленки фоторезиста и вмещаться в поле зрения МИИ-4 (оценивается визуально по изображению в микроскопе). Ступеньку с пологим (наклонным) краем получают после экспонирования и проявления, "нерезкого края" на границе тени за непрозрачным экраном из металлической фольги. При экспонировании, экран закрывает часть пленки фоторезиста, а его край приподнят, примерно на 1,5-2,0 мм от поверхности пленки фоторезиста.

Проявление ведут в проявителе.

Проявленную пленку фоторезиста, с полученной ступенькой и с пологим (наклонным) краем (рис. 4) промывают в дистиллированной воде, сушат на центрифуге, а затем направляют на интерференционные измерения толщины.

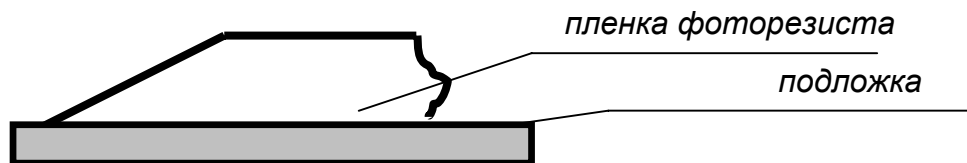


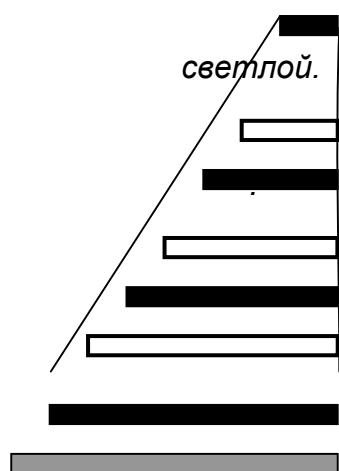
Рис.4 Формирование ступеньки фоторезиста с наклонным краем

4.7.1.2.3. Проведение испытания.

В МИИ-4 на пологом наклонном краю ступеньки пленки фоторезиста визуально отсчитывают целое или полуцелое число интерференционных полос (m) равной толщины (темных и/или светлых), укладывающихся в измеряемую толщину пленки

фоторезиста в свете зеленого интерференционного фильтра, встроенного в осветителе микроинтерферометра.

Пример:



m

3,5 :4-я темная полоса на поверхности пленки=1/2

3,0 :3-я светлая полоса

3-я темная полоса

2,0 :2-я светлая полоса

2-я темная полоса

1,0 :1-я светлая полоса

:1-я темная полоса

:поверхность подложки

Итого: $m = 3,0 + 1/2 = 3,5$ полосы, отсчитанные в пленке на МИИ-4

4.7.1.2.4. Обработка результатов

Толщину пленки фоторезиста представляют в числах интерференционных полос отсчитанных в МИИ-4 в пленке на не окисленном кремнии согласно выражению (2).

По приведенному примеру:

$$N = (m - \varphi) = (3,5 - 0,5) = 3,0 \text{ полосы.}$$

Погрешность измерения составляет $\pm 1/4$ интерференционной полосы (независимо от толщины пленки).

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если толщина пленки фоторезиста соответствует п. 4, таблицы. 1 настоящих ТУ.

Для сопоставления измеренной толщины пленки в числах N с общепринятой геометрической толщиной d в мкм на не окисленном кремнии вычисляют по формуле:

$$d = N * 0,176 \text{ мкм} = (m - \varphi) * 0,176 \quad (3)$$

в приведенном примере толщина пленки, в мкм, измеренная на длине волны $L = 0,534$ мкм, на не окисленном кремнии ($\varphi = 0,5$), оценивается величиной:

$$d = (3,5 - 0,5) * 0,176 \approx 0,528 \text{ мкм}$$

Примеры для различных величин N приведены в приложении 4.

и аналогично, например:

4.7.2. Профилографический метод.

Метод предназначен для определения толщины пленки фоторезиста на профилографе - профилометре.

4.7.2.1. Принцип измерения.

Метод основан на принципе сканирования по исследуемой поверхности алмазной иглой и преобразования колебаний иглы в изменение напряжения индуктивным методом.

4.7.2.2. Оборудование.

Профилограф-профилометр по ГОСТ 19300-86.

4.7.2.3. Проведение испытания.

Пластина, с изображением рисунка, полученного по п. 4.5.3 закрепляют на призме профилографа - профилометра при помощи вакуумированного столика таким образом, чтобы при движении датчика пластина оставалась неподвижной. Устанавливают режим работы на профилографе:

вертикальное увеличение 20000, скорость трассирования датчика 0,6 мм/мин, скорость перемещения бумаги на записывающем приборе 30 мм/мин. В соответствии с инструкцией по эксплуатации профилографа измеряют толщину пленки (высоту ступеньки профилограммы) в пяти любых точках на линиях, соединяющих между собой модули изображения фотошаблона-теста (рис. 5).

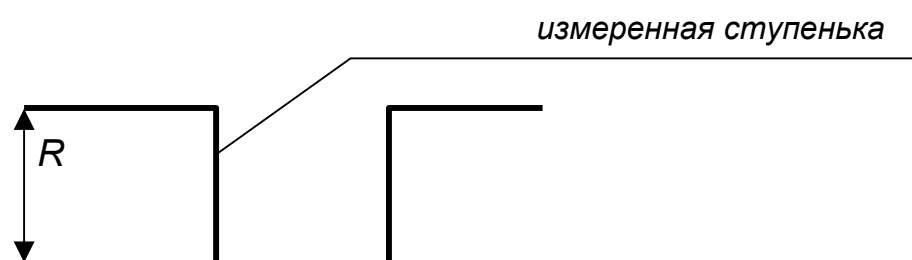


Рис.5. Измерение толщины пленки на профилографе - профилометре

4.7.2.4 Обработка результатов.

Толщину пленки вычисляют по формуле:

$$h = \frac{\sum_{i=1}^n Ri * 1000}{20000 * n} \quad (5)$$

где h - толщина пленки фоторезиста, мкм;

$\sum_{i=1}^n Ri * 1000$ - сумма значений величины ступенек на профилограмме

для пяти замеров, в мкм;

20000 - вертикальное увеличение профилографа;

n - число замеров.

Результаты испытаний считают положительными, если толщина пленки фоторезиста соответствует требованиям п.5 таблицы. 1 настоящих технических условий.

4.8. Определение устойчивости пленки фоторезиста к проявителю.

4.8.1. Оборудование, реактивы.

Термометр лабораторный №2 с диапазоном измерения температуры от 0 до 100 °С и ценой деления шкалы 1 °С по ТУ 25-2021.003-88 или аналогичный.

Секундомер механический по ГОСТ 5072-79 или аналогичный.

Проявитель, приготовленный по п.4.5.2.1

4.8.2. Проведение испытания.

Испытания проводят на трех пластинах, подготовленных по п.4.4.3.

Пластину с пленкой фоторезиста погружают в ванну с 80 см³ проявителя при температуре 19-21 °С и включают секундомер. По секундомеру фиксируют время растворения пленки фоторезиста.

4.8.3. Обработка результатов.

Устойчивость пленки фоторезиста в проявителе определяют по формуле:

$$t_{cp} = \frac{\sum_{i=1}^3 t_i}{3} \quad (6)$$

где t_{cp} - устойчивость пленки фоторезиста к проявителю, сек;

t_i - время устойчивости пленки фоторезиста на i -й пластине, сек.

Результаты испытаний считают положительными, если устойчивость пленки фоторезиста к проявителю соответствует требованиям п.6 таблицы.1 настоящих технических условий.

4.9. Определение относительной скорости фильтрации фоторезиста.

Метод определения относительной скорости фильтрации фоторезиста основан на сравнении времени фильтрации первой и четвертой порций фоторезиста через мембранный фильтр при постоянном давлении фильтрования.

4.9.1. Оборудование, материалы, посуда и реактивы.

Манометр с верхним пределом измерения избыточного давления 160кПа (1,6 кгс/см²) и классом точности не ниже 4-ого по ГОСТ 2405-88.

Секундомер механический СОПпр-2А-3 по ГОСТ 5072-79 с ценой деления 0,2с или аналогичный.

Редуктор для регулирования давления азота РДФ-3 по ТУ 25.02.1898-75 или аналогичный.

Устройство для фильтрования жидких сред под давлением, каталожный № SM 16249 фирмы «Sartorius» или аналогичное.

Пинцет лабораторный по ТУ 45-6А0.005.088 ТУ-86 или аналогичный

Мембранные фильтры «Владипор» типа МФЦ №2 по ТУ 6-05-1978-84 диаметром 50 мм, допускается использование других, стойких к органическим растворителям фильтров с диаметром пор 0,20-0,25 мкм.

Бязь хлопчатобумажная (отбеленная), по ГОСТ 11680-76, салфетки размером 100x100 мм.

Цилиндр 1-100 ГОСТ 1770-74

Азот газообразный по ГОСТ 9293-74, высший сорт.

Спирт этиловый ректифицированный технический по ГОСТ 18300-87, высший сорт.

1,4-Диоксан по ГОСТ 10455-80, ч.д.а.

4.9.2. Подготовка к испытанию.

Бязевой салфеткой, смоченной спиртом, протирают устройство для фильтрования и сушат на воздухе.

Расход спирта 15 см³.

Сборку устройства осуществляют в соответствии с инструкцией по эксплуатации, устанавливая при этом один фильтр МФЦ №2

4.9.3. Проведение испытания.

Испытания проводят в вытяжном шкафу. В фильтрующее устройство заливают около 50 см³ фоторезиста. Через 1-2 мин, при помощи редуктора, подают в фильтрующее устройство избыточное давление азота равное 100 кПа (1 кгс/см²). В момент появления первой капли отфильтрованного фоторезиста включают секундомер. По получении 40 см³ отфильтрованного фоторезиста останавливают секундомер и прекращают подачу сжатого азота.

Доливают в фильтрующее устройство еще 40-45 см³ фоторезиста и определяют время фильтрования второй порции (40 см³) фоторезиста. Эту операцию повторяют до получения 160 см³ отфильтрованного фоторезиста. Если конструкция фильтрующего устройства позволяет залить сразу 160-180 см³, то допускается проводить фильтрование в один прием, определяя время прохождения каждой порции 40 см³. При использовании фильтрующего устройства с диаметром 90 и 142 мм общее количество отфильтрованного фоторезиста и величина каждой порции должны быть увеличены пропорционально увеличению площади фильтра по сравнению с площадью фильтра диаметром 50 мм. Время истечения первой порции фоторезиста при использовании МФЦ-2 не должно превышать 350 с. Испытания проводят дважды.

Расхождения между результатами двух испытаний не должно превышать 50%.

Относительную скорость фильтрации рассчитывают по формуле

$$\frac{t_4 + t_4'}{t_1 + t_1'} \leq 2, \quad (7)$$

где t_1 и t_4 – время фильтрации первой и четвертой порции фоторезиста при первом измерении

t_1 и t_4 – время фильтрации первой и четвертой порции фоторезиста при втором измерении

Результат испытаний считают положительным, если относительная скорость фильтрации соответствует требованиям п.7 табл. 1 настоящих технических условий.

4.10. Определение массовой доли воды в фоторезисте.

4.10.1. Оборудование, материалы, посуда, реактивы.

Шкаф сушильный электрический, обеспечивающий температуру нагрева до 350 С.

Колонка стеклянная цилиндрическая высотой 600 мм и внутренним диаметром 30 мм, с оттянутым концом до диаметра 4-5 мм.

Термометр технический стеклянный ТТП №9 по ТУ 25-2021.003-88ТУ 25-2021.010-89 или аналогичный.

Цилиндр 1-1000 ГОСТ 1770-74.

Цеолиты (молекулярные сита) типа КА или NaA по ТУ 38.102.81-88.

Стекловата.

1,4-Диоксан по ГОСТ 10455-80.

4.10.2. Подготовка к испытанию.

4.10.2.1. Абсолютирование диоксана.

Стеклянную цилиндрическую колонку заполняют сначала слоем стекловаты на высоту 10 мм, а затем на высоту не менее 500 мм цеолитом, предварительно прокаленным при температуре 320 °С в течение 8 ч.

Через подготовленную колонку пропускают 1000 см³ 1,4-диоксана. Массовая доля воды в абсолютированном диоксане должна быть не более 0,05%.

Абсолютированный диоксан хранят в чистой, сухой, герметично закрытой емкости. При хранении соблюдают все меры предосторожности против попадания влаги воздуха в диоксан.

4.10.3. Проведение испытания.

Массовую долю воды в фоторезисте определяют по ГОСТ 14870-77 разд.2 реактивом Фишера, используя в качестве растворителя 1,4-диоксан, подготовленный по п.4.10.2.1.

Результаты испытаний считают положительными, если массовая доля воды соответствует требованиям п.8 табл.1 настоящих технических условий.

4.11. Определение массовой доли сухого остатка.

4.11.1. Оборудование, материалы, реактивы.

Весы равноплечные 2 класса точности с пределом взвешивания до 200г по ГОСТ 24104-2001 или аналогичные.

Набор гирь 2 класса точности, тип Г-2-210, ГОСТ 7328-2001.

Шкаф сушильный электрический, обеспечивающий температуру от 60 до 200 °С, с точностью ±3 °С.

Эксикатор 2-190 ГОСТ 25336-82

Алюминиевая чашка с крышкой диаметром 70-90 мм, высотой 5-10 мм и массой не более 50 г и стаканчик для взвешивания СН-45/13 или СН-60/14 ГОСТ 25336-82.

Пипетка 1-2-1-0,1 ГОСТ 29227-91.

Кальций хлористый технический по ГОСТ 450-77, прокаленный.

4.11.2. Проведение испытания.

Навеску фоторезиста массой 0,5-0,7 г берут пипеткой, быстро переносят в чашку, предварительно высушенную до постоянной массы. Чашку закрывают крышкой и взвешивают с погрешностью не более 0,001 г. Открытую чашку с навеской испытуемого фоторезиста, распределенного ровным слоем по дну чашки, и крышку помещают в сушильный шкаф с температурой 97±3 °С и сушат в течение 3 ч с промежуточным взвешиванием после 2 ч сушки.

Перед каждым взвешиванием пустую чашку и чашку с фоторезистом выдерживают одно и то же время (15-20 мин) в эксикаторе над прокаленным хлористым кальцием.

4.11.3. Обработка результатов.

Массовую долю сухого остатка вычисляют по формуле

$$P = \frac{(m_2 - m_1)}{m} * 100, \quad (8)$$

где P – массовая доля сухого остатка, %

m – масса навески фоторезиста, г.

m_1 – масса чашки, г.

m_2 – масса чашки с фоторезистом, г.

За результат испытания принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, расхождение между которыми не должно превышать 1,0% абсолютный.

Результаты испытаний считают удовлетворительными, если содержание массовой доли сухого остатка соответствует п.9 табл. 1 настоящих технических условий.

4.12. Определение массовой доли НХД-групп в пересчете на сухой остаток.

4.12.1. Принцип измерения.

Метод основан на измерении оптической плотности раствора фоторезиста в максимуме поглощения при длине волны 399±2 нм.

4.12.2. Оборудование, материалы, реактивы.

- Спектрофотометр СФ-26 или любой другой, позволяющий проводить измерения в диапазоне спектра 350-410 нм и

обеспечивающий точность измерения с погрешностью не более $\pm 1\%$ (абс.) по шкале коэффициентов пропускания.

- Кварцевые кюветы К-10, ГОСТ 20903-75 с расстоянием между рабочими гранями 10 мм (прилагаются к спектрофотометру), допустимое отклонение расстояния между гранями $\pm 0,03$ мм.
- Весы лабораторные равноплечные 2 класса модели ВЛР-20 ГОСТ 24104-2001 или аналогичные с погрешностью взвешивания в диапазоне взвешивания до 5 г не более 0,0001 г.
- Весы лабораторные равноплечные 2 класса модели ВЛР-200 ГОСТ 24104-2001 или аналогичные с погрешностью взвешивания не более 0,0005 г.
- Набор гирь 2 класса точности Г-2-21, 105, ГОСТ 7328-2001.
- Набор гирь 2 класса точности Г-2-210, ГОСТ 7328-2001.
- Колбы 2-1000-2, 2-100,2 ГОСТ 1770-74.
- Капельница 2-25 ХС ГОСТ 25336-82 или пипетка Лунге.
- Стаканчик СВ-24/10 ГОСТ 25336-82
- Воронка В-25-38 ХС ГОСТ 25336-82
- Диоксан, ГОСТ 10455-80, ч.д.а.
- Хромат калия, ГОСТ 4459-75, х.ч. содержание основного вещества не менее 99,5%
- Калия гидроокись, ГОСТ 24363-80, х.ч. концентрации с (КОН)=0,05 моль/дм³

4.12.3. Подготовка к испытанию.

4.12.3.1. Приготовление растворов хромата калия, измерение оптических плотностей.

Готовят две серии, каждая из 7 растворов хромата калия в растворе гидроокиси калия. Для этого на аналитических весах ВЛР-20 берут следующие навески хромата калия: 0,0100 г, 0,0150 г, 0,0200 г, 0,0250 г, 0,0300 г, 0,350 г и 0,0400 г, с учетом содержания основного вещества, взвешивание с погрешностью не более 0,0001 г. Навесы переносят в мерные колбы вместимостью 1000 см³ и объем доводят до метки раствором гидроокиси калия. Полученные растворы тщательно перемешивают и измеряют их коэффициенты пропускания $T(S)$ на длине 375 нм относительно раствора гидроокиси калия, который был использован в качестве растворителя. Для каждого раствора измерения проводят 2 раза. За результат принимают среднее арифметическое двух измерений.

Оптическая плотность полученных растворов рассчитывается по формуле

$$DK_2C_4O_4 = -\lg \frac{\bar{T}(S)}{100}, \quad (9)$$

где $DK_2C_4O_4$ – оптические плотности полученных растворов

$\bar{T}(S)$ – среднее арифметическое двух наблюдений.

Для каждой концентрации раствора хромата калия – $C_iK_2C_4O_4$ находят соответствующую оптическую плотность $D_iK_2C_4O_4$, как среднеарифметическое значение в двух сериях растворов.

Общая масса посуды с навеской не должна превышать 5 г, в противном случае погрешность взвешивания будет больше 0,0001 г.

ПРИМЕЧАНИЕ. На спектрофотометре СФ-46 измеряют непосредственно оптическую плотность растворов (D).

4.12.3.2. Построение графика поправок.

По полученным значениям $C_iK_2C_4O_4$ и $D_iK_2C_4O_4$ строят график зависимости оптической плотности (D) от концентрации (C). Для этого по оси абсцисс откладывают значения концентрации растворов ($C_iK_2C_4O_4$) в масштабе $1 \text{ см} = 2,0 \text{ мг/дм}^3$, по оси ординат найденные значения оптической плотности ($D_iK_2C_4O_4$) в масштабе $1 \text{ см} = 0,020$.

Полученные точки соединяют между собой и с началом координат плавной кривой. На этом же графике проводят прямую, соответствующую табличному значению молярного коэффициента экстинкции хромата калия. Для этого соединяют прямой начало координат и точку, соответствующую оптической плотности (D)=0,991 и концентрации (C)=40 мг/дм³. (А. Гордон «Спутник Химика») Расстояние по вертикали между двумя линиями является поправкой (ΔD), которую в дальнейшем необходимо прибавить к найденным значениям оптической плотности ($D_{\text{изм}}$), чтобы получить исправленное значение оптической плотности ($D_{\text{исп.}}$) анализируемых растворов. Поправка (ΔD) положительна, если построенная кривая проходит на графике ниже табличной прямой. В противном случае поправка (ΔD) имеет отрицательный знак.

График поправок строят один раз в квартал и проверяют после каждого мелкого ремонта и наладки спектрофотометра.

Для каждого спектрофотометра строят свой график поправок.

4.12.4. Выполнение измерений.

Капельницу или пипетку Лунге с фоторезистом взвешивают на весах ВЛР-200, 0,5-0,7 г (3-4 капли) фоторезиста переносят в мерную колбу вместимостью 100 см³ с 20-30 см³ диоксана и закрывают притертой пробкой. По разности находят массу перенесенного фоторезиста с точностью 0,0005 г. Раствор в колбе перемешивают, доводят до метки диоксаном и еще раз тщательно перемешивают. Затем измеряют коэффициент пропускания (T , %) приготовленного раствора относительно диоксана в максимуме поглощения $\lambda = 399 \pm 2 \text{ нм}$.

Измерения повторяют два раза. За результат наблюдения принимают среднее арифметическое значение двух измерений.

4.12.5. *Обработка результатов.*

Оптическую плотность раствора фоторезиста рассчитывают по формуле

$$D_{изм} = -\lg \bar{T}(S) / 100 \quad , \quad (11)$$

*где $D_{изм}$ – оптическая плотность растворов фоторезиста
 $\bar{T}(S)$ – среднее арифметической двух измерений пропускания анализируемого раствора.*

По графику поправок находят исправленное значение $D_{исп}$

$$D_{исп} = D_{изм} + \Delta D \quad , \quad (12)$$

Массовую долю НХД-групп в фоторезисте вычисляют по формуле

$$X = \frac{249,2 * D_{исп} * V * 100 * 100}{E * H * l * P} \quad , \quad (13)$$

где X – массовая доля НХД-групп в фоторезисте; в пересчете на сухой остаток, в %

$D_{исп}$ – оптическая плотность анализируемого раствора фоторезиста с учетом поправки

249,2 – молекулярная масса НХД-групп, г/моль

P – массовая доля сухого остатка, %

V – объем колбы, в которой растворяли навеску, $дм^3$

*E – молярный коэффициент экстинкции НХД-групп в эфирах, производных 1,2-НХД-(2)-5-сульфо кислоты равный $8025 дм^3/моль * см$*

H – масса навески пробы фоторезиста, г

l – расстояние между рабочими гранями кюветы, см.

За результат принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, относительное значение расхождения между которыми не превышает значения допустимого расхождения, равного 3%.

Пределы допустимого значения относительной суммарной погрешности анализа $\pm 3,5\%$ при доверительной вероятности $P=0,95$.

Результаты испытаний считают удовлетворительными, если массовая доля НХД-групп соответствует требованиям п. 10 табл. 1 настоящих технических условий.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

5.1. *Транспортирование.*

Фоторезист перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При транспортировании следует обеспечить поддержание температуры фоторезиста $(20 \pm 5) ^\circ C$.

5.2. *Хранение.*

Фоторезист хранят в упаковке предприятия-изготовителя в закрытом складском помещении, снабженном приточно-вытяжной вентиляцией, при температуре $20 \pm 5^\circ C$ и относительной влажности воздуха не более

80%. Фоторезист следует предохранять от воздействия солнечного света, влаги, паров кислот и щелочей.

6. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

Работа с Фоторезистом должна проводиться в отдельном помещении, снабженном приточно-вытяжной вентиляцией, при следующих условиях окружающей среды:

температура воздуха $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$;

относительная влажность воздуха от 40 до 60%.

Запрещается работать с фоторезистом вблизи открытых источников нагревания.

При работе с фоторезистом следует предохранять фоторезист от попадания влаги, паров кислот, щелочей, аммиака, механических и других примесей, защищать фоторезист от актиничного освещения. Перед применением фоторезист фильтруют на фильтре "Владипор" или аналогичном с диаметром пор не более 0,2 мкм, устойчивом к растворителям, содержащим ацетатную группу. Срок использования фоторезиста после фильтрации устанавливается индивидуально каждым потребителем. По истечении этого времени фоторезист фильтруют повторно.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества Фоторезиста требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения. Гарантийный срок хранения Фоторезиста 6 месяцев со дня изготовления.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ В НАСТОЯЩИХ ТУ**

Таблица 3

ГОСТ 12.1.005-88	ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 17.2.3.02-78	ССБТ «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями»
ГОСТ 12.1.044-89	ССБТ «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»
ГОСТ 12.1.007-76	ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
ГОСТ 12.4.011-89	ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация
ГОСТ 12.4.021-75	ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования
ГОСТ 12.4.103-83	ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация
ГОСТ 33-2000	Нефтепродукты. Метод определения кинематической и расчет динамической вязкости
ГОСТ 3885-73	Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка и маркировка
ГОСТ 7376-89	Картон гофрированный
ГОСТ 13841-95	Ящики из гофрированного картона для химической продукции
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 14870-77	Методы определения содержания воды
ГОСТ 17622-72	Стекло органическое техническое
ГОСТ 19433-88	Грузы опасные. Классификация и маркировка
ГОСТ 20477-86	Лента полиэтиленовая с липким слоем
ГОСТ 27025-86	Реактивы. Общие указания по проведению испытаний
ГОСТ Р 51477-1999	Бутылки коричневого цвета БВ-1-1000
ТУ 6-09-5311-89	Средства укупорочные из полимерных материалов для стеклянной потребительской тары для химических реактивов
ТУ 6-09-5472-90	Тара стеклянная для химических реактивов и особо чистых веществ
ТУ 6-19-110-78	Тара из полимерных материалов для химических реактивов

Таблица 3 (окончание)

ТУ 13-0281099-01-90	Бумага светонепроницаемая
ГОСТ 10028-81	«Вискозиметры капиллярные стеклянные. Технические условия»
Техническое описание и инструкция по эксплуатации устройства для нанесения фоторезиста в скафандре типа ЦНФ ДЕ 4.932-000 ТО.	
Техническое описание и инструкция по эксплуатации электропечи диффузионной типа СДО.	
Микроинтерферометр Линника МИИ-4. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.	
Техническое описание и инструкция по эксплуатации установки совмещения и экспонирования.	
Пост вакуумный универсальный ВУП 4. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.	
Профилограф-профилометр. Техническое описание инструкция по эксплуатации.	
Ротаметр типа РМ. Паспорт.	
Фотошаблон-тест, черт.И6М7.409.605 НИИМЭ.	
Фотошаблон-тест. Технологическая инструкция И60.045.309 ТИ НИИМЭ.	

**ПЕРЕЧЕНЬ
ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ, ПОСУДЫ И РЕАКТИВОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ФОТОРЕЗИСТА**

Метрологическое оборудование

Таблица 4

Люксметр, позволяющий замерить освещенность в пределах 40000-50000 Лк.
Микроинтерферометр Линника МИИ-4 по ТУ 3-3.1145-81 или аналогичный
Фотошаблон-тест, черт. И 6М7.409.557 НИИМЭ
Устройство контроля плотности проколов УКПП.И6М3.259.001 НИИМЭ
Секундомер механический по ГОСТ 5072-79.
Профилограф - профилометр по ГОСТ 19300-86 или аналогичный.
Весы лабораторные 2 класса точности моделей ВЛР-20 и ВЛР-200 по ГОСТ 24104-2001.
Весы лабораторные квадрантные 4 класса модели ВЛК-500г-М по ТУ 25-06.1101-79 или аналогичные.
ГОСТ 7328-2001: «Гири. Общие технические условия»
Термометры технические стеклянные ТТП по ТУ 25-2021.010-89 или аналогичные.
Термометр лабораторный №2 с диапазоном измерения температуры от 0 до 100 °С и ценой деления шкалы 1 °С по ТУ 25-2021.003-88 или аналогичный.
Цилиндр 1-10, 1-25, 1-100 и 1-1000 по ГОСТ 1770-74.
Мензурка 1000 ГОСТ 1770-74.
Бюретки 1-2-25-0,1; 3-2-50-0,1 и пипетка 1-2-1-0,1; 6-2-5 по ГОСТ 20292-74.
Пинцет лабораторный по ТУ 45-6АО.005.088 ТУ-86 или аналогичный.

Прочее оборудование и материалы

Таблица 5

Электродуховка диффузионная СДО-125/3-12,0 или аналогичная.
Устройство для нанесения фоторезиста в скафандре ЦНФ по ДЕМ 3.281.008 ТУ или аналогичное.
Установка совмещения и экспонирования (УСЭ) типа ЭМ-576 или аналогичная.
Шкафы сушильные электрические, обеспечивающие температуру нагрева от 60 до 200 °С и до 350 °С.
Источник питания постоянного тока Б5-49 ЕЭЗ.233.220 ТУ или аналогичный с напряжением 0-100 В.
Шприц "Sartorius" SM 16620 с фильродержателем SM 16214 или аналогичный.
Ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ по ГОСТ 13045-81 с регулятором расхода воздуха РРВ-1.
Баня водяная лабораторная одноместная по ТУ 10-23-28-87.
Ванна, черт. 619.4659 Опытного завода МНПО «НИОПИК» или аналогичная.
Кассета фторопластовая, черт. 619.4660.01 Опытного завода МНПО «НИОПИК» или аналогичная.
Пост вакуумный универсальный ВУП-4 по ТУ 25-05-1771-75 или аналогичный.
Пинцет лабораторный по ТУ 45-6А0.005.088 ТУ-86 или аналогичный.
Пластины монокристаллического кремния диаметром 40 , 60 или 76 мм.
Манометр с верхним пределом измерений избыточного давления 160 кПа(1,6 кгс/см) и классом точности 1 по ГОСТ 2405-88.
Редуктор для регулирования давления азота с фильтром РДФ-3 по ТУ 25.02.1898-75 или аналогичный.
Устройство для фильтрования жидких сред под давлением, каталожный № SM 16249 фирмы "Sartorius" Германия или аналогичное.
Проволока из алюминия марки А-995 диаметром 0,35-0,50 мм по ТУ 48-21-574-77.
Проволока вольфрамовая марки ВА по ОСТ 11.021-002-76 диаметром 1,0 мм.
Фильтры бумажные обеззоленные "синяя лента" по ТУ 6-09-1678-86.
Мембранный фильтр "Владипор" типа МФЦ N 2 по ТУ 6-05-1978-84.
Бумага фотографическая «Унибром» №3 – 7 по ГОСТ 10752-79
Фиксаж универсальный по ТУ 6-17-989-78 или аналогичный
Проявитель универсальный по ТУ 6-17-1002-85 или аналогичный.
Бязь хлопчатобумажная (отбеленная) по ГОСТ 11680-76, салфетки размером 100x100 мм.
Батист отбеленный по ГОСТ 8474-80, салфетки размером 100 x 100 мм.

Таблица 5 (окончание)

Вата хлопчатобумажная.
Воронки В-36-80 ХС и В-100-150 ХС, капельница 2-25 ХС, стаканчик СВ 24/10 по ГОСТ 25336-82.
Стакан 7 ГОСТ 9147-80.
Стакан Н-2-500 ТХС ГОСТ 25336-82.
Кварцевые кюветы К-10 по ГОСТ 20903-75
Банки полиэтиленовые БЦ-250 и БЦ-1000 по ТУ 6-19-110-78.
Цеолиты (молекулярные сита) типа КА или NaA по ТУ 38.102.81-88.
Стекловата.
Спирт этиловый ректифицированный технический по ГОСТ 18300-87, высший сорт.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.
Вода деионизованная ОСТ 11.029.003-80.
Кислота серная по ГОСТ 4204-77.
Кислота фтористоводородная осч 27-5 по ТУ 6-09-3401-88
Калий двуххромовокислый по ГОСТ 4220-75.
Калий хромово-кислый по ГОСТ 4459-75
Ацетон по ГОСТ 2603-79, ч.д.а.
Аммоний фтористый по ГОСТ 4518-75, ч.д.а. или аммоний фтористый осч 5-4 по ТУ 6-09-827-76.
Бромкреозоловый пурпурный (индикатор) по ТУ 6-09-07-1603-87, массовая доля 0,1%
Бромтимоловый синий (индикатор) по ТУ 6-09-2086-77, массовая доля 0,1%
Смешанный индикатор, приготовленный по ГОСТ 4919.1-77, со значением рН перехода окраски 6,7.
1,4-Диоксан по ГОСТ 10455-80, ч.д.а.
Калия гидроокись, ГОСТ 24363-80, раствор с молярной концентрацией с(КОН)=1,0 моль/дм .
Кальций хлористый технический по ГОСТ 450-77
Кислород газообразный технический по ГОСТ 5583-78 изм. 1,2,3,4.
Азот газообразный технический по ГОСТ 9293-74, высший сорт.

ЗАО «Фраст-М»

ФОТОРЕЗИСТ ПОЗИТИВНЫЙ ФП-РН-7Сэ

Партия № _____

Массой _____ кг.

ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<i>Наименование показателя</i>	<i>Норма</i>	<i>Фактически</i>
1. Внешний вид	Прозрачная жидкость красно-коричневого цвета, без осадка	
2. Кинематическая вязкость, мм/сСт	2,2 ÷ 2,8	
3. Относительная скорость фильтрации фоторезиста, отн. ед., не более	2	
4. Массовая доля сухого остатка, %, в пределах	19.0 ÷ 22.0	
5. Массовая доля НХД-групп в пересчете на сухой остаток, %, в пределах	11.5 ÷ 15.0	
6. Минимальная ширина воспроизводимого элемента	1,0	
7. Толщина пленки фоторезиста, мкм	0,5 ÷ 0,8	
8. Устойчивость пленки фоторезиста к проявителю, мин., не менее	3	
9. Массовая доля воды, %, не более	0,6	
10. Внешний вид пленки	Прозрачная, блестящая, без разрывов	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

В комплект поставки входит фоторезист ФП-РН7Сэ в упаковке и паспорт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Фоторезист позитивный ФП-РН-7Сэ соответствует техническим условиям ТУ 2378-006-29135749-2007 и признан годным для применения.

Дата выпуска _____

Начальник ОТК _____

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие фоторезиста требованиям ТУ 2378-006-29135749-2007 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и применения, указанных в технических условиях.

Гарантийный срок хранения – шесть месяцев со дня изготовления.

Указания по хранению.

Фоторезист хранят в упакованном виде в сухом помещении при 15-25 °С и относительной влажности воздуха 45 ÷ 80%. Следует предохранять фоторезист от попадания влаги, механических и прочих примесей, защищать его от действия дневного света, света люминесцентных ламп и ламп накаливания.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
(к методу 2, п. 4.7.1.2.5.)

Расчет толщины пленки фоторезиста в мкм для различных значений $N=(m-\varphi)$:

Таблица 6

Значение "N"	Значение "m"	Толщина пленки, мкм
для N=2,5;	m=3,0;	$d=(3,0-0,5) \times 0,176 \approx 0,44$
для N=3,0;	m=3,5;	$d=(3,5-0,5) \times 0,176 \approx 0,529$
для N=3,5;	m=4,0;	$d=(4,0-0,5) \times 0,176 \approx 0,616$
для N=4,0;	m=4,5;	$d=(4,5-0,5) \times 0,176 \approx 0,704$
для N=4,5;	m=5,0;	$d=(5,0-0,5) \times 0,176 \approx 0,792$
для N=5,0;	m=5,5;	$d=(5,5-0,5) \times 0,176 \approx 0,880$
для N=5,5;	m=6,0;	$d=(6,0-0,5) \times 0,176 \approx 0,968$
для N=6,0;	m=6,5;	$d=(6,5-0,5) \times 0,176 \approx 1,056$
для N=6,5;	m=7,0;	$d=(7,0-0,5) \times 0,176 \approx 1,144$
для N=7,0;	m=7,5;	$d=(7,5-0,5) \times 0,176 \approx 1,232$
для N=7,5;	m=8,0;	$d=(8,0-0,5) \times 0,176 \approx 1,320$
для N=8,0;	m=8,5;	$d=(8,5-0,5) \times 0,176 \approx 1,408$
для N=8,5;	m=9,0;	$d=(9,0-0,5) \times 0,176 \approx 1,496$
для N=9,0;	m=9,5;	$d=(9,5-0,5) \times 0,176 \approx 1,584$
для N=9,5;	m=10,0;	$d=(10,0-0,5) \times 0,176 \approx 1,672$
для N=10,0;	m=10,5;	$d=(10,5-0,5) \times 0,176 \approx 1,760$
для N=11,0;	m=11,5;	$d=(11,5-0,5) \times 0,176 \approx 1,936$
для N=12,0;	m=12,5;	$d=(12,5-0,5) \times 0,176 \approx 2,112$
для N=13,0;	m=13,5;	$d=(13,5-0,5) \times 0,176 \approx 2,288$
для N=14,0;	m=14,5;	$d=(14,5-0,5) \times 0,176 \approx 2,464$
для N=15,0	m=15,5;	$d=(15,5-0,5) \times 0,176 \approx 2,64$ мкм

При длине волны L интерференционного фильтра, отличного от зеленого (0,534 нм по паспорту) результаты расчетов могут корректироваться.

